

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 1 区分

【発行日】平成 23 年 5 月 12 日 (2011.5.12)

【公開番号】特開 2008-285402 (P2008-285402A)

【公開日】平成 20 年 11 月 27 日 (2008.11.27)

【年通号数】公開・登録公報 2008-047

【出願番号】特願 2008-128370 (P2008-128370)

【国際特許分類】

C 0 3 B 7/094 (2006.01)

C 0 3 B 7/088 (2006.01)

C 0 3 B 7/096 (2006.01)

C 0 3 C 3/089 (2006.01)

C 0 3 C 3/091 (2006.01)

G 0 2 F 1/1333 (2006.01)

【 F I 】

C 0 3 B 7/094

C 0 3 B 7/088

C 0 3 B 7/096

C 0 3 C 3/089

C 0 3 C 3/091

G 0 2 F 1/1333 5 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成 23 年 3 月 30 日 (2011.3.30)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

溶融塊の温度が処理期間中 1760 を越えているプロセスであって、

破片材料あるいは原材料を溶融して溶融塊とする工程、

前記溶融塊を精製する工程、及び

前記溶融塊をイリジウムあるいはイリジウムを少なくとも 50 重量%含むイリジウム合金から成る抜取管(4)を通して不連続的なプロセスで注ぎ出す工程から成る前記処理によって高融点ガラス材料、ガラスセラミック材料、あるいはセラミック材料を製造する方法であって、

酸素を含む周辺雰囲気と接触している前記抜取管(4)の一部分の温度が、前記抜取管から溶融塊を注ぎ出す期間中を除き、常に 1000 未満になるように制御あるいは調節されることを特徴とする前記方法。